Netsu Sokutei 28 (3) 135-143

解説

# 非水系溶液配位化学と滴定カロリメトリー

# 石黒慎一 , 小宮守人

(受取日: 2000年11月27日,受理日: 2000年12月5日)

# Nonaqueous Solution Coordination Chemistry Studied by Titration Calorimetry

Shin-ichi Ishiguro and Morito Komiya

(Received November 27, 2000; Accepted December 5, 2000)

Titration calorimetry is a powerful tool for determining thermodynamic parameters of metalion complexation in non-aqueous solvents. By using this method, we could have simultaneously obtained formation constants and enthalpies of not only binary but also ternary metal complexes. The enthalpy and entropy values of metal-ion complexation reflect the change in the solvation number, and thus provide useful information on the coordination structure of metal complexes in solution. In non-aqueous solvent, unlike water, solvent-solvent interaction (solvent structure) in the bulk liquid is generally weak, and solvation steric effect operates upon coordination of bulky solvent molecules to the metal ion. This leads to an enhanced complexation of anionic ligands such as halide ions, even in an aprotic donor solvent that has a stronger donor property than water. Here, the results on the formation thermodynamics and structure of metal-ion complexes will be discussed from the view-point of solvation steric effect.

### 1. はじめに

非水系における金属イオンの錯形成挙動は水溶液中と大 きな違いがあり,これを利用して金属錯体の合成や有機金 属錯体を触媒とする有機合成反応が行われている。水溶液 と異なる非水系の錯形成挙動を熱力学および構造化学的に 明らかにすることは,我々が常識としている水の性質が如 何に特異的であるかを理解する上でも重要な役割を果たす。 金属イオンと配位子の溶液組成を広い範囲で変化させたと き,単一錯体種しか生成しないような反応系は希であり, 多くの場合,組成に依存して様々な錯体種が生成する。こ のため,溶液の性質は溶液組成,特に生成する錯体種に強 く依存する。そこで,溶液現象を考えるとき,最初に,ど んな錯体種が生成し,それらの生成分布がどうなっている か,を知る必要がある。安定度定数が決定できれば,生成 錯体の化学量論を明らかにすることができる。安定度を調 べる方法として電位差滴定法,分光光度滴定法などが一般 によく用いられており,精度も高い。しかし,水溶液系で 有効なガラス電極も,非水系では必ずしも有効ではない。 有機溶媒中で働く電極の種類は限られる。分光光度滴定法 は汎用性が高いが,可視・紫外部に吸収を持たない反応系 には適用できない。一方,反応熱にともなう微少な温度変 化を測定する精密滴定カロリメトリーは,どんな溶媒や反 応系に対しても適用できるので,電位差滴定法や分光光度 滴定法に比べて汎用性が高い。したがって,非水系で安定 度を調べるのに適している。

我々は,これまで精密滴定カロリメトリーにより様々な 溶媒中で金属イオンの錯形成反応を調べ,生成錯体の熱力

© 2001 The Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis.

学的パラメータを決定してきた。その一部は既に総説にま とめられている。<sup>1-7)</sup> ここでは,金属イオンの錯形成におけ る溶媒和の立体効果と,三元錯体の研究成果を中心に,主 に熱力学的な観点から考察してみる。なお,全自動滴定力 ロリメトリーの装置,測定法およびデータ解析法について は,既に詳細を紹介しているのでここでは省略する。<sup>8)</sup>

#### 2. イオン溶媒和

溶液中で金属イオンは溶媒和クラスターを形成している。 この溶媒和による安定化エネルギーは1価イオンでは数100 kJ mol-1であり,2価金属イオンでは2000 kJ mol-1,3価 金属イオンでは5000 kJ mol-1 に達する。この値は錯形成反 応のエネルギーに比べて遙かに大きい。9) 錯形成反応では, 金属イオンと溶媒分子の結合が切断され,新たに金属イオ ンと配位子の結合が形成される。錯形成のエネルギー変化 は,これら二つの大きな結合エネルギーの差であり,結合 エネルギーに比べて小さい。金属イオンの溶媒和エネルギ ーは溶媒に依存するので,溶媒を替えると金属イオンと溶 媒分子の結合エネルギーが変わり, 錯形成挙動が一変する。 さらに, 有機溶媒分子は水分子に比べて嵩高く, 金属イオ ンに複数の溶媒分子が配位すると溶媒分子間に立体効果が 働く。これも金属イオンの配位数や結合エネルギーを大き く変化させる要因である。金属イオンに比べると弱いが、 配位子もまた溶媒和している。配位子の溶媒和エネルギー は金属イオンに比べて小さいが,電荷を持つ配位子の溶媒 和は数100 kJ mol-1 に達する。一方, 電荷のないものは静 電的な溶媒効果を一般に受けにくい。しかし,水素結合能 を持つ中性配位子では,水素結合を形成するプロトン性溶 媒と,水素結合を形成しない非プロトン性溶媒で反応性に 顕著な差が現れる。さらに生成した錯体の溶媒和も錯体の 安定度を大きく左右する。これについては,ここでは割愛 する。

反応のエンタルピー変化は,原子間結合の形成と切断に 由来するものであり,構造情報は,エンタルピー変化を結 合と結びつけて考える上で不可欠である。溶媒和金属塩結 晶を単離するのは容易ではないが,これまで,幾つかの結 晶構造が報告されている。最近,ビスマス(III)の水和物, ジメチルプロピレン尿素およびジメチルスルホキシド (DMSO)溶媒和物の結晶構造がスエーデンのグループによ って報告されている。<sup>10)</sup>ジメチルホルムアミド(DMF)や ジメチルアセトアミド(DMA)溶媒和金属塩の結晶構造で は,6個の溶媒分子が金属イオンに結合している。<sup>11,12)</sup> – 方,溶液中の溶媒和金属イオンの配位数や中心金属イオン と配位原子間距離はX線回折法やEXAFSにより研究され ており,既に多数の報告がある。<sup>13)</sup>



**Fig.1** Formation constant of ZnCl<sup>+</sup> as a function of donor number of solvents.

# 3. 溶媒クラスター構造

溶液中でランダムに激しく動き回っている溶媒分子の分 子間距離は時間と共に変動するので,分子間に特定の配置 を持たない。この場合,溶液X線回折では,原子間距離が 変化しない分子内構造のみが情報として得られる。しかし, 分子間に特異な相互作用が働き,特定の配置をとるとき, 分子内構造に加えて分子間構造が見えてくる。これが溶媒 のクラスター構造である。水分子は周りの四つの水分子と 結合し,四面体を基本とした三次元クラスターを形成する。 非水溶媒も水ほど顕著ではないが,様々な大きさのクラス ターを形成することがわかってきた。一般に,アルコール やアミドなどプロトン性溶媒は水素結合性クラスターを形 成する。一方,非プロトン性溶媒は,水素結合する置換基 を持たないのでクラスターを形成する能力が低い。しかし、 ジメチルスルホキシドのように,双極子モーメントが支配 的に働いて形成されるクラスター構造もある。さらに非プ ロトン性溶媒とプロトン性溶媒の混合溶媒では,溶媒組成 に依存して様々なタイプの分子アダクトが生成するので, これを利用して溶媒クラスター構造をコントロールできる。 溶媒の混合熱は溶媒クラスターの形成に関連している。し たがって,溶液内反応の熱力学的パラメータは混合の熱力 学的過剰量と結びつけて解釈できるであろう。混合溶媒で は,溶媒が均一に混合する系は限られており,多くはミク 口的に不均一であることが解ってきた。しかし,溶媒のク ラスター化が溶液内反応に及ぼす効果については,まだ十 分に研究されていない状況である。溶媒のクラスター化は, 特にイオン会合反応のエントロピー変化を著しく減少させ る。一方,反応の前後で電荷が変化しない中性配位子の錯 形成では,顕著な効果を示さない。反応速度に及ぼす溶媒 クラスターの影響も未開拓な分野であり,反応種に限定し た反応メカニズムの説明も再考する必要があると考えられ



Fig.2 Calorimetric titration curves for the Zn(II)-Cl · system in DMA and DMF at 298 K.  $C_{ZN,int}$  stands for the concentration of zinc(II) ion in an initial solution.

る。この問題に関しては,本題から逸れるのでここでは割 愛する。

#### 4. 溶媒和の立体効果

溶媒のドナー数は溶媒分子の電子対供与性の尺度として Gutmann により提唱された溶媒パラメータである。14) ドナ ー数の大きな溶媒ほど金属イオンと強い結合を形成し,モ ノクロロ錯体の生成定数は逆に小さくなることが知られて いる。亜鉛(II)イオンのモノクロロ錯体の生成定数log K を溶媒のドナー数DN に対してプロットしたものをFig.1 に 示す。ドナー数の小さなアセトニトリル (AN) から, 大き なジメチルスルホキシド (DMSO) に向かってlog K値は 直線的に小さくなる。これがドナー数から予想される振る 舞いである。しかし,この関係から大きくはずれる溶媒が ある。実際,ジメチルアセトアミド(DMA)はジメチルホ ルムアミド (DMF) とドナー数はほとんど変わらないが, ジメチルアセトアミド中の生成定数は104倍も大きい。さ らにヘキサメチルリン酸トリアミド (HMPA) 中の生成定 数はドナー数から予想される値よりも1010倍も大きい。-方,メタノールや水溶液中の生成定数はドナー数から予想 される値の10-4および10-7倍と小さい。したがって,溶 媒を選択することにより生成定数をコントロールすること ができる。生成定数を大きくする要因は溶媒和の立体効果 であり,小さくする要因はバルクの溶媒クラスター形成で ある。ここでは,溶媒和の立体効果について,以下に詳し く述べることにする。

#### 4.1 亜鉛(II)クロロ錯体生成

ジメチルアセトアミド (DMA) が金属イオンに溶媒和す る際に,そのアセチル基が立体障害となる。立体効果が強 く働くと配位数の低下を引き起こす。立体効果が弱いと配 位数は低下しないが,溶媒和構造は不安定化する。その結 果,ジメチルアセトアミド中の錯形成挙動は,立体効果が

ほとんど働かないジメチルホルムアミド中に比べて著しく 変化する。その一例として,滴定カロリメトリーで得られ た亜鉛(II)錯体のクロロ錯体生成の滴定曲線をFig.2に示 す。この図は,過塩素酸亜鉛(II)のジメチルホルムアミド およびジメチルアセトアミド溶液を塩化テトラエチルアン モニウム溶液で滴定し,各滴定点での測定値- $q/(C_{Cl,tit}\delta v)$ (qは反応熱の測定値,  $C_{Cl,tit} \ge \delta_v$ は加えた塩化テトラエチ ルアンモニウム溶液の濃度と体積)を溶液中の配位子と金 属イオンの濃度比C<sub>Cl</sub>/C<sub>Zn</sub>に対してプロットしたものであ り,見かけのエンタルピー変化である。見かけのエンタル ピー変化は,もし生成錯体が一種類で,その生成定数が大 きければ測定される反応熱は一定となり,その値はそのま ま生成エンタルピー変化となる。実際の反応系では,この 例のように,複数の錯体が生成し,それらは互いに異なる 生成エンタルピー変化の値をもっているので,見かけのエ ンタルピー変化は複雑な挙動を示す。ここで -  $q/(C_{Cl,tit}\delta_v)$ が負の場合が発熱反応,正の場合が吸熱反応である。ジメ チルホルムアミド中ではFig.2の場合, $C_{Cl}/C_{Zn}$ が2までは 吸熱であるが,その後,発熱に変わり,C<sub>Cl</sub>/C<sub>Zn</sub>が3以上で は徐々に発熱が小さくなる。一方,ジメチルアセトアミド 中では全溶液組成で発熱であり, Ccl/Czn が3以上ではジメ チルホルムアミド中の挙動と類似している。亜鉛(II)イオ ンがモノ、ジ、トリおよびテトラクロロ錯体を生成すると すると,これら実験点はすべて再現できる。すなわち,各 点の発熱量qは,以下の式で表せる。

$$q_{i,\text{calc}} = -\Delta H_{\beta 1} \,^{\circ} \beta_1 (V_i \, m_i \, x_i - V_{i-1} m_{i-1} x_{i-1}) \\ -\Delta H_{\beta 2} \,^{\circ} \beta_2 (V_i \, m_i \, x_i^2 - V_{i-1} m_{i-1} x_{i-1}^2) \\ -\Delta H_{\beta 3} \,^{\circ} \beta_3 (V_i \, m_i \, x_i^3 - V_{i-1} m_{i-1} x_{i-1}^3) \\ -\Delta H_{\beta 4} \,^{\circ} \beta_3 (V_i \, m_i \, x_i^4 - V_{i-1} m_{i-1} x_{i-1}^4)$$
(1)

ここで, $\beta_n$ および $\Delta H_{\beta_n}$ °は反応Zn<sup>2+</sup>+nCl<sup>-</sup> = ZnCl<sub>n</sub><sup>(2-n)+</sup> における錯体の全生成定数と全生成エンタルピー変化であ

**Table 1** Stepwise thermodynamic parameters for reaction, $ZnCl_{n \cdot 1}^{(3 \cdot n)+} + Cl \cdot = ZnCl_{n}^{(2 \cdot n)+}$  in N,N-dimethylformamide and N,N-dimethylacetamideat 298 K.<sup>15,16)</sup>

n	1	2	3	4
DMF				
$\log K_n / \text{mol dm} \cdot 3$	4.8	7.0	5.3	2.2
$\Delta H_n$ %J mol - 1	14.7	1.4	- 17.6	- 7.9
$\Delta S_n$ °/J K · <sup>1</sup> mol · <sup>1</sup>	142	139	42	16
DMA				
$\log K_n / \text{mol dm} \cdot 3$	8.6	7.8	5.0	1.9
$\Delta H_n$ %J mol <sup>-1</sup>	- 1.7	- 20.6	- 16.9	- 10.4
$\Delta S_n \circ J \mathrm{K} \cdot \mathrm{I} \mathrm{mol} \cdot \mathrm{I}$	159	80	39	2

る。 $V_i$ ,  $m_i$ ,  $x_i$  は実験点iにおける溶液の体積と遊離金属イオンおよび遊離塩化物イオン濃度である。 $m_i \ge x_i$ の値と,溶液中の全金属イオン濃度 $C_{M,i}$ および塩化物イオン濃度 $C_{X,i}$  との間には,次式のマスバランス関係が成立する。

 $C_{M,i} = m_i + \beta_1 m_i x_i + \beta_2 m_i x_i^2 + \beta_3 m_i x_i^3 + \beta_3 m_i x_i^4$ (2)  $C_{X,i} = x_i + \beta_1 m_i x_i + 2\beta_2 m_i x_i^2 + 3\beta_3 m_i x_i^3 + 4\beta_3 m_i x_i^4$ (3)

全金属イオン濃度 $C_{M,i}$ および塩化物イオン濃度 $C_{X,i}$ は各 実験点で既知であるので,各錯体の生成定数を仮に与えれ ば式(2)と式(3)から遊離金属イオンmiおよび遊離塩化物イ オン濃度xi が計算できる。この値を使って,式(1)から最小 二乗法によりエンタルピー変化を計算する。最初に与えた 仮の生成定数の値は正しくないので,誤差二乗和U=  $\Sigma(q_{i,calc} - q_{i,obsd})^2$ は大きな値を持っている。そこで誤差二 乗和が小さくなるように生成定数を修正し,これを使って 再度エンタルピー変化を計算する。このプロセスを繰り返 すことで,誤差二乗和が最小となる全生成定数と全生成工 ンタルピー変化を最終的に求めることができる。Fig.2中の 実線は,このような非線形最小二乗法で求められたモノ, ジ,トリおよびテトラクロロ錯体の全生成定数と全生成エ ンタルピー変化を用いて計算された滴定曲線である。様々 な溶液組成条件下で得られた実験点を全て再現しているこ とがわかる。

得られた生成定数とエンタルピー変化から,逐次反応 ZnCl<sub>n-1</sub>( $^{3-n}$ )++Cl<sup>-</sup>=ZnCl<sub>n</sub>( $^{2-n}$ )+の熱力学的パラメータは 以下のように求められる。

$K_n = \beta_n / \beta_{n-1}$	
$\Delta G_n \circ = -2.303 RT \log K_n$	
$\Delta H_n \circ = \Delta H_{\beta_n} \circ - \Delta H_{\beta(n-1)} \circ$	
$\Delta S_n \circ = (\Delta H_n \circ - \Delta G_n \circ)/T$	(4)

得られた熱力学的パラメータをTable 1に示す。

ジメチルアセトアミド中のトリおよびテトラクロロ錯体 の生成パラメータの値は,対応するジメチルホルムアミド 中とほぼ同じ値である。一方,モノおよびジクロロ錯体の 生成パラメータには溶媒間で大きな違いがある。これはジ メチルアセトアミド中で溶媒和の立体効果が働き,亜鉛(II) イオン - 溶媒間結合エネルギーや配位構造に異常が発生し ていることを示唆している。実際,EXAFSとラマンスペク トルから亜鉛(II)イオンはジメチルホルムアミド中298 K で4配位と6配位の化学種が共存し,次式のような構造平衡 が成立していることが結論されている。<sup>17)</sup>

 $Zn(DMA)_{6^{2+}} = Zn(DMA)_{4^{2+}} + 2DMA$ (5)

この反応においては,  $Zn(DMA)_{6^{2+}} in 2 分子のDMA を解$  $離するので, <math>\Delta H^{\circ} > 0$  および  $\Delta S^{\circ} > 0$  である。一方, ジク 口口錯体は, ジメチルホルムアミドおよびジメチルアセト アミド中のいずれでも,4配位四面体であり,2分子の溶媒 分子が結合している。4配位錯体では,配位空間に余裕があ り溶媒和の立体効果は働かない。ジクロロ錯体の全生成エ ンタルピーおよびエントロピーはジメチルアセトアミド中 で,それぞれ-22.3 kJ mol<sup>-1</sup>および239 J K<sup>-1</sup> mol<sup>-1</sup>であり, ジメチルアセトアミド中の対応する値,16.1 kJ mol<sup>-1</sup>およ び281 J K<sup>-1</sup> mol<sup>-1</sup>と比較すると,エンタルピー,エントロ ピーのいずれも小さくなっている。したがって,ジメチル ホルムアミド中で溶媒和の立体効果が働かないとすると,ジ メチルアセトアミド中での立体効果の大きさは,エンタル ピーおよびエントロピー値で38.4 kJ mol<sup>-1</sup>および42 J K<sup>-1</sup> mol<sup>-1</sup>程度であると見積もれる。

4.2 二価遷移金属イオンの溶媒和構造

錯形成の熱力学的パラメータに対する溶媒和の立体効果 を理解するために、溶媒和構造に関する知見が重要である。 溶媒和錯体の構造パラメータをTable 2に示す。いずれの 溶媒も酸素原子で金属イオンに結合しているが,その金属 イオンと酸素原子の結合距離 r/pm と結合数n を, 立体効果 の働かない水およびジメチルホルムアミドと立体効果が働 くジメチルアセトアミド,テトラメチル尿素(TMU)およ びヘキサメチルリン酸トリアミドを比較している。二価遷 移金属イオンに酸素原子で結合する溶媒の配位数は6が-般的であるが,前に述べたように亜鉛(II)イオンのジメチ ルアセトアミド和物の平均配位数は4.6に、さらに強い立体 効果が働くテトラメチル尿素では5, ヘキサメチルリン酸 トリアミドでは4に低下している。このような配位数の低 下している溶媒中での錯形成反応は通常の溶媒中とは顕著 な違いを呈する。実際,どのような挙動をとるのかを具体 的な例で見てみよう。

#### 非水系溶液配位化学と滴定カロリメトリー

		Water H <sub>2</sub> O	DMF OHCN(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	DMA O(CH <sub>3</sub> )CN(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	$TMU \\ \{(CH_3)_2N\}_2CO$	HMPA {(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N} <sub>3</sub> PO
Mn(II)	<i>r</i> /pm	217	216	216	209	2007
	n	6	5.8	5.8	4.9	4.9
Fe(II)	r/pm	211	210		205	198
	n	6	5.8		4.9	4.0
Co(II)	r/pm	208	208	207	200	195
	n	6	5.9	5.5	4.1	3.9
Ni(II)	r/pm	205	204	205	200	197
	n	6	5.9	5.9	4.8	4.2
Cu(II)	<i>r</i> <sub>ex</sub> /pm	197	196	196	192	192
	n <sub>ex</sub>	4	4.1	4.1	3.9	3.7
Cu(II)	<i>r</i> <sub>ax</sub> /pm	229	229	227		
	n <sub>ax</sub>	2	2	1.8		
Zn(II)	r/pm	207	208	199	195	193
	n	6	5.8	4.6	3.8	4.1
Cd(II)	<i>r</i> /pm	227			228	223
	n	6			5.9	4.8

Table 2 Structural parameters of transition metal ions in solution at 298 K.

DMF: N,N-dimethylformamide, DMA: N,N-dimethylacetamide, TMU: tetramethylurea, HMPA: hexamethylphosphoric triamide.



**Fig.3** Species distribution in *N*,*N*-dimethylformamide and *N*,*N*-dimethylacetamide.

## 4.3 金属錯体の生成分布

亜鉛(II)イオンのクロロ錯体の生成について詳しく述べ たが,他の遷移金属イオンについても同様なカロリメトリ ー測定と解析ができ,一連のモノ,ジ,トリおよびテトラ 錯体が生成することがわかった。得られた生成定数を用い て計算される錯体の生成分布をFig.3に示す。

イオン半径の小さなベリリウム(II)イオンはジメチルホ ルムアミド中でも4配位であり,溶媒和の立体効果を受け にくいイオンである。実際,ジメチルホルムアミドとジメ チルアセトアミド溶媒中のクロロ錯体の生成分布に本質的 な違いはない。一方,6配位八面体構造を取りやすい遷移金 属イオンでは二つの溶媒で生成分布に大きな違いが発生す

**Table 3** Stepwise thermodynamic parameters for<br/>reaction,  $NiCl_{n-1}(3-n)+ + Cl - = NiCl_n(2-n)+ in N,N-$ <br/>dimethylformamide and N,N-dimethylacetamide<br/>at 298 K.

п	1	2	3	4
DMF				
$\log K_n / \text{mol dm} \cdot 3$	2.85	0.91	1.77	1.87
$\Delta H_n$ %J mol $\cdot$ 1	8.6	19.1	62.9	- 13.4
$\Delta S_n $ °/J K $^{-1}$ mol $^{-1}$	84	82	245	- 9
DMA				
$\log K_n / \text{mol dm} \cdot 3$	4.31	4.22	4.51	1.73
$\Delta H_n$ %J mol $^{-1}$	28.4	22	- 3.3	- 6.4
$\Delta S_n \circ J \mathrm{K} \cdot \mathrm{I} \mathrm{mol} \cdot \mathrm{I}$	178	154	75	12

る。モノクロロ亜鉛(II)、ジクロロコバルド(II)およびトリ クロロニッケル(II)錯体は、ジメチルホルムアミド中でほと んど生成しないが、ジメチルアセトアミド中では強く生成す る。一方、ジメチルホルムアミド中で生成するモノクロロニ ッケル(II)、ジクロロ亜鉛(II)およびモノクロロカドミウム (II)錯体はジメチルアセトアミド中では生成が弱められる。 このように溶媒和の立体効果は、生成錯体の種類(相対的な 生成定数の大きさ)も変える働きを持っていることが一つの 特徴である。この原因は、立体効果のため、クロロ錯体の配 位構造が二つの溶媒で違うことに由来している。この現象を ニッケル(II)クロロ錯体について、詳しく見てみよう。

4.4 ニッケル(II)クロロ錯体の溶液内構造

ジメチルホルムアミドおよびジメチルアセトアミド中で



**Fig.4** Intrinsic electronic spectra of  $\operatorname{NiCl}_n^{(2-n)*}(n = 1-4)$ in *N*,*N*-dimethylformamide at 298 K. The value shows *n* in the complex.



**Fig.5** Intrinsic electronic spectra of  $\operatorname{NiCl}_n^{(2-n)+}(n = 1-4)$ in *N*,*N*-dimethylacetamide at 278 K (dotted line), 298 K (solid line) and 318 K (broken line).

ニッケル (II)イオンは6配位八面体構造を取っており,溶 液は水溶液中と同じく淡緑色をしている。この溶液に塩化 テトラエチルアンモニウムを加えていくと四面体のクロロ 錯体が生成し溶液の色は濃青色に変わる。この反応をカロ リメトリーで調べると一連のモノ,ジ,トリおよびテトラ クロロ錯体が生成し,それらの熱力学的パラメータを決定 できる。一方,分光光度滴定により,吸収スペクトル変化 を測定し,これを解析することにより,各錯体の生成定数 と固有の電子スペクトルを求めることができる。したがっ て,生成定数は滴定カロリメトリーと分光光度滴定のいず れからも得られるが,それらの値は同じであり,反応熱の 発生が金属イオンの電子状態の変化に由来することを示し ている。

Table 3を見ると,非常に大きな正の逐次生成エンタル ピーおよびエントロピー値が,ジメチルホルムアミド中で は,トリクロロ錯体の生成時に,またジメチルアセトアミ ド中では,モノおよびジクロロ錯体の生成時に発生してい る。これは溶媒和の立体効果のため,溶媒和錯体の6配位 構造から4配位構造への変化が,ジメチルアセトアミド中 では低次の錯形成段階で起こることを反映している。亜鉛 (II)とちがって,ニッケル(II)ではトリクロロ錯体が二つ の溶媒中で四面体となる。では,モノおよびジクロロ錯体 はどのような構造をとっているのであろうか。ジメチルホ ルムアミドおよびジメチルアセトアミド中での各錯体の電 子スペクトルをそれぞれFig.4およびFig.5 に示す。

トリおよびテトラクロロ錯体は600~800 nm に強い吸収 帯を持ち,これは四面体構造に特有であり,ジメチルホル ムアミドとジメチルアセトアミドで大きな違いがない。ま た,ジメチルアセトアミド中でも温度依存性を示さない。 これは構造異性体がないことを示唆している。一方,モノ およびジクロロ錯体の電子スペクトルには溶媒間で大きな 違いがあり,ジメチルアセトアミド中で顕著な温度依存性 を示す。ジメチルホルムアミド中のモノおよびジクロロ錯 体は溶媒和錯体と同様,6配位八面体構造に特有な弱い吸 収帯を示す。ジメチルアセトアミド中の吸収帯は6配位八 面体構造に帰属できない。また,温度依存性があり,これ らの錯体には構造異性体があることを示している。モノク ロロ錯体の吸収帯は5配位ニッケル(II)イオンに特有であり, 温度依存性は,式(6)のような5配位と6配位の構造平衡が あることを示唆している。

$$Ni(DMA)_{5^{2+}} + DMA = Ni(DMA)_{6^{2+}}$$
 (6)

6配位錯体の吸収帯は5配位錯体の吸収帯と重なり,かつ 強度が弱いので見えない。温度が上昇すると強度が増すの は,平衡が5配位構造にシフトするためである。一方,ジ クロロ錯体の電子スペクトルでは等吸収点があり,式(7)の 構造平衡が成立していることを示している。

$$NiCl_2(DMA)_{3^{2+}} = NiCl_2(DMA)_{2^{2+}} + DMA$$
 (7)

5 配位錯体と4 配位錯体の吸収帯はいずれも強度が強く, また吸収波長も異なるため等吸収点が発生する。温度の上 昇とともに5 配位錯体の強度が弱まり,4 配位錯体の強度が 強まる。5 配位モノクロロ錯体に比べて5 配位ジクロロ錯体

		from $\Delta H_n$ °	from $\Delta S_n$ °
in DMF	$\Delta C_{p1}$ °	0.02	- 0.02
in DMA	$\Delta C_{p1}$ °	0.20	0.22
	$\Delta C_{p2}$ °	- 0.09	- 0.05
	$\Delta C_{p3}$ °	- 0.24	- 0.23
	$\Delta C_{p4}$ °	- 0.01	0.00

**Table 4** Molar heat capacity changes for reaction,<br/> $NiCl_{n-1}^{(3-n)+} + Cl^{-} = NiCl_n^{(2-n)+}$  in N,N-dimethyl-<br/>formamide and N,N-dimethylacetamide at 298 K.

**Table 5** Stepwise thermodynamic parameters for reaction,  $CoCl_{n-1}^{(3-n)+} + Cl^{-} = CoCl_n^{(2-n)+}$  in hexamethylphosphoric triamide at 298 K.

	Cl	HMPA Br	Ι	DMF Cl
$\log K_1$	6.7	5.55	2.69	3.43
$\log K_2$	4.2	3.19	0.89	3.42
$\log K_3$	2.7	0.79		4.99
$\log K_4$	0.8			2.29
$\Delta H_1$ °	- 15.2	- 2.7	13.0	6.3
$\Delta H_2$ °	- 12.6	- 0.3	6.9	52.2
$\Delta H_3$ °	- 12.8	2.1		- 24.8
$\Delta H_4$ °	- 8			- 6.2
$\Delta S_1 \circ$	78	97	95	87
$\Delta S_2$ °	38	62	40	241
$\Delta S_3$ °	9	22		12
$\Delta S_4$ °	- 10			23
$\Delta S_{\beta4}$ °	115			363

の吸収波長は長波長シフトしており,これは塩化物イオン が弱い配位子場を提供していることを反映している。

クロロ錯体の生成熱力学的パラメータの温度依存性から, 反応に伴う比熱容量変化が以下のように見積もることが出 来る。

 $\Delta C_{pn} \circ = (\Delta H_n \circ / T)_p = T (\Delta S_n \circ / T)_p \tag{8}$ 

エンタルピーおよびエントロピーから見積もった比熱容 量変化をTable 4に示す。

構造異性体が存在しないジメチルホルムアミド中のモノ クロロ錯体生成,およびジメチルアセトアミド中のテトラ クロロ錯体生成の比熱容量変化は小さい。一方,ジメチル アセトアミド中で,生成種に構造異性体が存在するモノク ロロ錯体は正,反応種に構造異性体があるトリクロロ錯体 は負の大きな比熱容量変化を示す。また,反応種および生 成種のいずれも構造異性体が存在するジクロロ錯体の熱容 量変化は,打ち消しあって,比較的小さな値となる。ジメ チルアセトアミド中でのモノクロロ錯体の比熱容量が正に なるのは,モノクロロ錯体が6配位と5配位の構造平衡にあ り,温度が高くなると5配位の割合が増え,反応エンタル ピーがより吸熱的になることを反映している。

4.5 ヘキサメチルリン酸トリアミド中のコバルト(II) ハロゲノ錯体

Table 1の溶媒和構造からわかるように, ヘキサメチル リン酸トリアミド中では強い溶媒和の立体効果が働くため に, コバルト(II)イオンは4配位の溶媒和錯体として存在し ている。このため,溶液の色は通常見られる6配位錯体の ピンク色ではなく,いわゆるコバルトブルーと云われる濃 青色を呈する。この溶媒中でコバルト(II)ハロゲノ錯体は すべて四面体であり,錯形成は配位数の変化をともなわな い。実際, ヘキサメチルリン酸トリアミド中の値は,配位 数が6から4に変化するジメチルホルムアミド中でのハロゲ ノ錯体生成の熱力学的パラメータと比較すると,大きな違 いがある(Table 5)。

ヘキサメチルリン酸トリアミドはジメチルホルムアミド に比べて強い配位性を持っており,金属イオンと溶媒分子 の結合を切断する時,より大きなエネルギーを消費する。 それにも関わらず, ヘキサメチルリン酸トリアミド中の反 応は全て発熱(生成エンタルピーが負)であり,生成定数 はジメチルホルムアミド中に比べて大きい。4配位錯体中 では,6配位錯体中に比べ,金属イオンと塩化物イオンの結 合が著しく強まることを反映している。ジメチルホルムア ミド中では,6配位から4配位への構造変化がジクロロ錯体 の生成段階で起こるため,生成エントロピーは大きな正の 値をとるが,構造変化を伴わないヘキサメチルリン酸トリ アミド中では錯形成の進行とともに生成エントロピーは単 調に減少する。ヘキサメチルリン酸トリアミド中でのテト ラクロロ錯体生成の全生成エントロピー $\Delta S_{\beta4}$ °は,ジメチ ルホルムアミド中に比べて,非常に小さい値を示す。これ は,溶媒和錯体の配位構造の違いによるもので,ヘキサメ チルリン酸トリアミド中では脱溶媒和する溶媒数が少ない ことを反映している。

#### 5. 三元錯体の生成熱力学<sup>18-29)</sup>

金属イオンは一つの配位子を含む二元錯体だけでなく, 二つ以上の配位子を含む多元錯体を形成することができる。 多元錯体は二元錯体にはない,配位子間相互作用が発生す る。この配位子間相互作用をもたらす金属イオンの役割を 明らかにすることは,金属イオンの反応場特性を理解する 上で役に立つ。我々は,これまで,ビピリジンやフェナン トロリンなどとハロゲン化物イオンを含む2価遷移金属イ

反応系	中心金属イオンの配位数				
	(11)	(21)	(31)	(12)	(22)
Zn-Cl-bipy	6	4			
Zn-Br-bipy	6	4		6	
Zn-I-bipy	6	4		5	
Zn-SCN-bipy	6	6		6	6
Cd-Cl-bipy	6	4	5	6	6
Cd-Br-bipy	6	4	5	6	6
Cd-I-bipy	6	4		6	6
Cd-SCN-bipy	6	6	6	6	6
Mn-Cl-bipy	6	6		6	6
Mn-Br-bipy	6	6		6	
Mn-SCN-bipy	6	6	5	6	6
Ni-Cl-bipy	6	6		6	6
Ni-Br-bipy	6	6		6	
Cu-Br-bipy	6	5		5	
Cd-Cl-phen	6	6	5	6	6
Cd-Br-phen	6	6	5	6	6
Cd-SCN-phen	6	6	6	6	6
Zn-Cl-phen		4		6	6
Zn-Br-phen		4			6
Zn-I-phen		4 = 5			6
Zn-SCN-phen	6	6			6
Mn-Cl-phen	6	6	5	6	6
Mn-Br-phen	6	6		6	6
Mn-SCN-phen	6	6	6	6	6

**Table 6** Ternary complexes  $MX_m(N-N)_n^{(2-n)+}(mn)$ and their coordination number in N,N-dimethylformamide at 298 K.

オンの三元錯体についてジメチルホルムアミドやジメチル アセトアミド中で系統的な研究を行ってきた。ビビリジン やフェナントロリンは2座キレート配位子であり,金属イ オンに二つのN原子で配位し,一連の安定なモノ,ビスお よびトリスキレート錯体を生成する。これらはいずれも6 配位八面体構造を有しており,モノ錯体には四つ,ビス錯 体には二つの溶媒分子が結合している。溶媒分子は八ロゲ ン化物イオンと置換され三元錯体が生成する。一方,既に 述べたように八ロゲノ錯体が生成すると,配位構造が6配 位八面体から4配位四面体へと変化する。したがって,ど のような三元錯体が安定に生成するのか,その配位構造は どうなのか,また金属イオンと八ロゲン化物イオンの結合 エネルギーがビビリジンやフェナントロリンの配位によっ てどう変化するのか,など基本的な疑問が浮かび上がる。

これまで見出されているジアミンとハライドイオン(あ

るいはチオシアン酸イオン)を含む三元錯体種は全て単核 であり,一般に $MX_m(N-N)_n^{(2-n)+}(mn)$ と表すことができ る。一連の二価遷移金属イオン(Mn,Co,Ni,Cu,Zn, Cd)に対して,(11),(21),(31),(12),(22)の5種類の 錯体が見出されている。ただし,全ての金属イオンで,こ れらの錯体が生成するわけではない。また,同じ(mn)型の 錯体であっても中心金属イオンによって配位構造が異なる。 これまでに調べられた反応系について生成する錯体とその 配位構造をまとめてみるとTable 6のようになる。

ジアミン錯体は立体障害のためシス構造をとることが知 られている。したがって,ジアミンとハロゲン化物イオン をそれぞれ2分子配位した(22)錯体もシス構造で,隣接す るハロゲン化物イオン間には強い静電反発力が働き,八面 体構造はかなり歪んでいると考えられる。また(31)錯体は ハロゲン化物イオンを3分子,ジアミンを1分子配位した5 配位構造であり,カドミウム(II)イオンの場合,イオン半 径の小さなクロロおよびブロモ錯体は生成するが,イオン 半径が大きなイオド錯体は生成しない。トリハロゲノカド ミウム錯体はいずれも溶媒1分子を配位した4配位構造であ るので, ハライドイオンの大きさによって, カドミウム(II) イオンの配位空間の広さがCl > Br > Iと減少することを 示している。このことを考慮すれば,カドミウム(II)イオ ンよりイオン半径の小さな金属イオンでは,配位空間が狭 いので(31)錯体は生成しなくなる。実際,窒素原子配位の チオシアナト錯体を除けば,カドミウム(II)以外で,(31) 錯体が生成は比較的イオン半径の大きなマンガン(II)のク ロロ錯体でのみで見出された。

反応のエンタルピーおよびエントロピー変化は配位子間 相互作用について,より詳細な情報を提供する。紙面の都 合上,詳細な熱力学と構造に関しての説明は別の機会に譲 るが,三元錯体について二つの特徴を述べておくことにす る。第一は,八ロゲノ錯体生成にともなう八面体から四面 体への構造変化は,ジアミンが配位すると抑制される傾向 があることである。その傾向はフェナントロリンの場合に 特に強い。第二は,錯体の配位構造が同じ場合,金属イオ ンへの八ロゲン化物イオンの親和力が,金属イオンにジア ミンが配位していると高まることである。これは,金属イ オンとの結合を通して間接的に,あるいは,配位空間を通 して直接的に異種配位子間に相互作用が働いていることを 示している。

三元錯体と二元錯体は共存しているので,反応熱滴定曲 線は非常に複雑になる。したがって,三元錯体の熱力学的 パラメータを決定できるかどうかは,別途決定した各二元 錯体の熱力学的パラメータの精度に強く依存する。実験的 に難しいため,三元錯体の研究例は多くない。我々の開発 した滴定カロリメトリーは三元錯体の研究にも十分耐えう る精度を持っており,利用価値が高いことが理解していた だけたと思う。

#### 文 献

- S. Ishiguro and H.Ohtaki, Coord. Chem. 15, 237 (1987).
- 2) S. Ishiguro, Netsu Sokutei 18, 193 (1991).
- 3) S. Ishiguro, Pure & Appl. Chem. 66, 393 (1994).
- H. Ohtaki and S. Ishiguro, Ed.G.Mamantov and A.I.Popov, "Chemistry of Nonaqueous Solutions: Recent Advances" VHC Publishers, New York, pp.179-226 (1994).
- 5) S. Ishiguro, K. Kato, R. Takahashi, and S. Nakasone, *Rare Earths* 27, 61 (1995).
- 6) S. Ishiguro, Bul. Chem. Soc. Jpn. 70, 1465 (1997).
- Y. Umebayashi, R. Kanzaki, and S. Ishiguro, *Hyomen* 37, 596 (1999).
- Available on request to the E-mail address: analsscc @mbox.nc.kyushu-u.ac.jp.
- 9) J. Burges, "Ions in Solution", Horwod Publshing, (1999).
- 10) J. Näslund, I. Parsson, and M. Sandström, *Inorg.* Chem. **39**, 4012 (2000).
- 11) H. Suzuki and S. Ishiguro, Acta Cryst. c53, 1602 (1997).
- 12) H. Suzuki and S. Ishiguro, Acta Cryst. c54, 586 (1998).
- 13) H. Ohtaki and T. Radnai, *Chem. Rev.* **93**, 1157 (1993).
- V. Gutmann, "The Donor-Acceptor Approach to Molecular Interactions", Prenum, New York (1978).
- S. Ishiguro, K. Ozutsumi, and H. Ohtaki, *Bull. Chem.* Soc. Jpn. 60, 531 (1987).
- 16) M. Koide and S. Ishiguro, Z. Naturforsch 50a, 11 (1995).
- K. Ozutsumi, M. Koide, H. Suzuki, and S. Ishiguro, J. Phys. Chem. 97, 500 (1993).
- S. Ishiguro, L. Nagy, and H. Ohtaki, Bull. Chem. Soc. Jpn. 60, 2053-2058 (1987).
- S. Ishiguro, L. Nagy, and H. Ohtaki, Bull. Chem. Soc. Jpn. 60, 2865-2869 (1987).
- 20) S. Ishiguro, K. Ozutsumi, L. Nagy, and H. Ohtaki, J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1989, 655 (1989).
- S. Ishiguro and K. Ozutsumi, Bull. Chem. Soc. Jpn. 62, 2392 (1989).
- 22) S. Ishiguro, K. Ozutsumi, M. Miyauchi, and H. Ohtaki, *Inorg. Chem.* 28, 3258 (1989).
- S. Ishiguro, M. Miyauchi, and K. Ozutsumi, J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1990, 2035 (1990).

- 24) S. Ishiguro, K. Ozutsumi, and A. Yagasaki, Bull. Chem. Soc. Jpn. 63, 3030 (1990).
- 25) M. Koide, H. Suzuki, and S. Ishiguro, J. Solution Chem. 25, 1261 (1996).
- 26) M. Komiya, S. Yoshida, and S. Ishiguro, J. Solution Chem. 26, 997 (1997).
- M. Komiya, Y. Kobayashi, H. Meno, and S. Ishiguro, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 94, 2769 (1998).
- 28) M. Komiya, S. Yoshida, and S. Ishiguro, J. Solution Chem. 29, 165 (2000).
- 29) M. Komiya, T. Tamada, and S. Ishiguro, *Chem. Phys. and Phys. Chem.* in press.

# 要 旨

滴定カロリメトリーは非水溶媒系での金属イオンの錯形 成の熱力学的パラメータを決定する有力な方法である。こ れにより,二元錯体のみならず,複雑な三元錯体の溶液内 平衡を精密に解析でき,その生成定数とエンタルピーを同 時に決定できた。錯体の生成エンタルピーおよびエントロ ピーは反応に伴う金属イオンの溶媒和数の変化を反映し, 生成錯体の配位構造に関して有力な情報を提供する。水溶 液系と違って非水溶媒では,バルク溶媒の液体構造性が弱 いこと,また,溶媒分子が嵩高く,このため溶媒和の立体 効果が働くことが特徴である。その結果,水よりも配位性 の強い非プロトン性溶媒中でも,八ロゲン化物イオンのよ うなアニオン性配位子の金属錯体の生成が強く促進される。 これまで得られた結果を,特に溶媒和の立体効果の観点か ら紹介する。



石黒慎一 Shin-ichi Ishiguro 九州大学大学院理学研究院, Faculty of Sciences, Kyushu Univ., TEL. 092-642-2581, FAX. 092-642-2607, e-mail: ANALSSCC@mbox.nc.kyushu-u.ac.jp

小宮守人 Morito Komiya 九州大学大学院理学研究院, Faculty of Sciences, Kyushu Univ., TEL. 092-642-2583, FAX. 062-642-2607, e-mail: dckomscc@mbox.nc.kyushu-u.ac.jp